

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和3年4月8日(2021.4.8)

【公開番号】特開2019-203155(P2019-203155A)

【公開日】令和1年11月28日(2019.11.28)

【年通号数】公開・登録公報2019-048

【出願番号】特願2018-97404(P2018-97404)

【国際特許分類】

C 23 C 16/505 (2006.01)

H 01 L 21/3065 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

H 01 L 21/316 (2006.01)

【F I】

C 23 C 16/505

H 01 L 21/302 101 B

H 01 L 21/31 C

H 01 L 21/316 X

【手続補正書】

【提出日】令和3年2月16日(2021.2.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

前記シャワープレートの直下に設けられ、前記シャワープレートを通過する前記第1の容量結合プラズマ中のイオンを除去するイオントラップをさらに備える、請求項5に記載の成膜装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0040

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0040】

そこで、図10に示すように、成膜が進行した(a)の状態(図9の(b)と同じ状態)で、第2の容量結合プラズマP2の基板Wにイオンのアシストによるエッチング作用を及ぼして、膜の厚さを均一にすることによりストレスを調整する((b)参照)。これにより、凹部202への膜203の埋め込みが完了した時点で膜ストレスが低減される((c)参照)。